

间歇供N₂闭炉的纯氮离子渗氮工艺

作者: 钟 厉 韩 西 发表时间: 2004-2-1 10:38:07

基于纯N₂离解产生活性氮原子能量条件的基本理论和纯氮离子渗氮模型,研究了间歇供N₂闭炉纯氮离子渗氮新工艺以实现纯氮代替氨或氮-氢的离子渗氮.通过对渗氮层显微组织、相组成和硬度梯度的测定与分析,对纯氮离子渗氮工艺中N₂分子临界离解能进行了理论计算和试验验证.结果表明,纯氮离子渗氮存在电压门槛值,只有在700 V左右的高电压下,并且采用间歇供N₂闭炉方式进行离子渗氮,才能产生明显的渗氮效果.在相同的渗氮时间里,间歇供N₂闭炉的纯氮离子渗氮可获得比常规纯氮离子渗氮更好的渗氮效果.



[加入收藏]



[打印本页]



[网上投稿]



[关闭返回]

版权所有: 材料保护杂志社 中国表面工程信息网络中心 鄂ICP备05001264

Tel: 027-83330037 Fax: 027-83638752 E-mail: abc430030@126.com

短信平台: 编辑“材料保护”发送到106650120留言(0.1元/条,接收免费)